## This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-083417

(43)Date of publication of application: 22.03.2002

(51)Int.Cl.

G11B 5/738 C23C 14/06 C23C 14/35 G118 5/64

(21)Application number: 2000-271236

(71)Applicant:

HITACHI MAXELL LTD

HITACHI LTD

(22)Date of filing:

07.09.2000

(72)Inventor:

KIRINO FUMIYOSHI

**OTA NORIO** 

**TAKEUCHI TERUAKI** 

YANO AKIRA

**SAKAMOTO HARUMI** 

WAKABAYASHI KOICHIRO **MATSUNUMA SATORU** 

INABA NOBUYUKI

HONDA MITSUTOSHI

YAMAMOTO HIROTAKA **NAKAZAWA TETSUO** 

NAITO TAKASHI

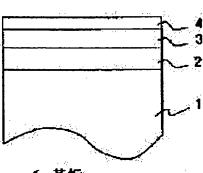
#### (54) MAGNETIC RECORDING MEDIUM AND MAGNETIC RECORDING DEVICE USING THE SAME

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a magnetic recording medium capable of highly precisely defining the position of a magnetic domain formed on an amorphous magnetic film and having high reliability and to provide a magnetic recording device provided with the magnetic recording medium.

SOLUTION: The magnetic recording medium 10 is provided with a base film 2 and the magnetic film 3 on a substrate 1. The base film 2 is constituted of a two-dimensionally and regularly arrayed hexagonal crystal grain and a grain boundary part enclosing the crystal grain. Recessed and projected parts are regularly formed on the surface of the base film by the crystal grain and the grain boundary. The recessed and projected parts corresponding to recessed and projected parts of the base film are formed on the magnetic film which is formed on the base film having such recessed and projected parts. The recessed and projected parts of the magnetic film function as pinning sites for preventing the movement of a magnetic domain wall. The magnetic domain formed on the magnetic film is highly precisely demarcated in a desired position. As a result, the magnetic recording medium having a reduced error and high reliability can be provided, since the fluctuation of the magnetic domain is reduced. Thus, >60 Gb/in2 super high density recording can be realized.





#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

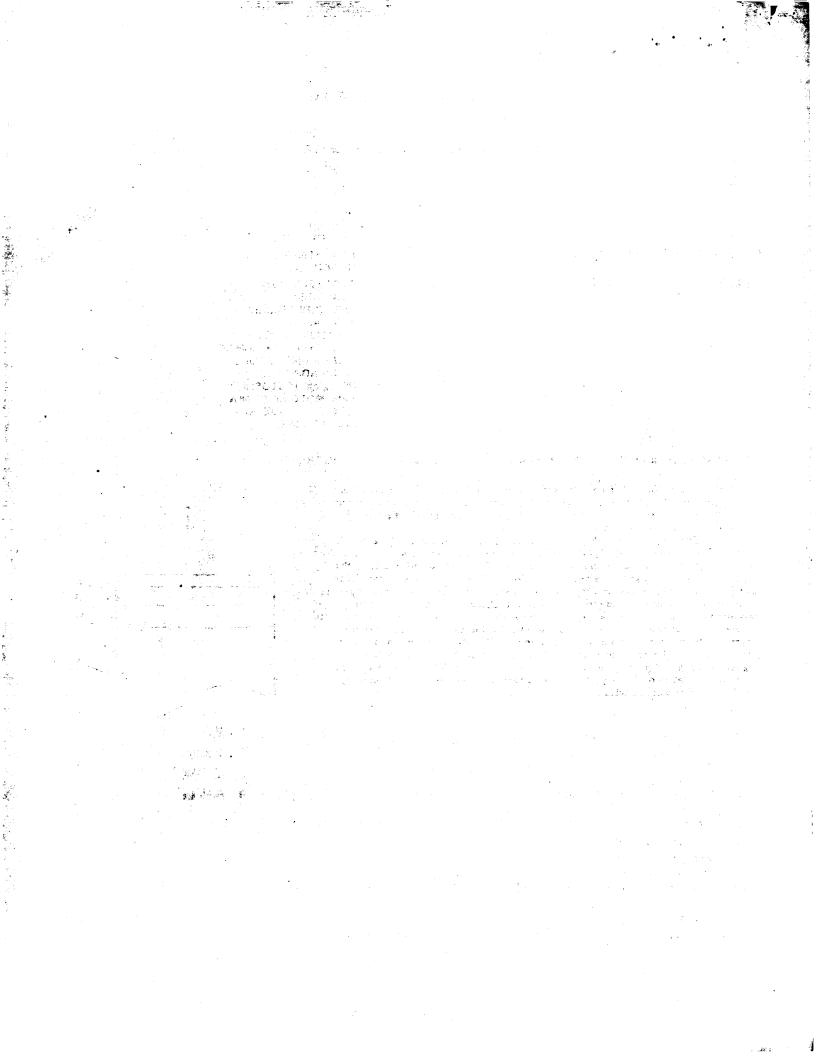
[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]



## Japan se Publicati n f r Un xamined Pat nt Applicati n No. 83417/2002 (Tokukai 2002-83417)

#### A. Relevance of the above-identified Document

This document has relevance to claims 1, 7, 13, 19, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, and 39 of the present application.

## B. <u>Translation of the Relevant Passages of the Document</u> [ABSTRACT]

#### [MEANS TO SOLVE THE PROBLEMS]

... regularly forms roughness on a surface of the base film. The magnetic film that is formed on the base film having the roughness has roughness corresponding to the roughness on the base film. The roughness on the magnetic film functions as a pinning site for preventing the domain-wall movement.

#### [CLAIMS]

#### [CLAIM 1]

A magnetic recording medium, comprising:

a base film and an amorphous magnetic film on a substrate,

... forming roughness on a surface of the base film.
[CLAIM 9]

	•		Section 1	, 🖫 ,
			•	
·				
		,		

... a difference between a height of the convex portion and a height of the concave portion is 3 nm through 10 nm.

#### [CLAIM 13]

... each of the crystal grains has a diameter in a range from 5 nm to 15 nm.

#### [CLAIM 16]

The magnetic recording medium as set forth in any one of claims 1 through 15, wherein:

roughness reflecting the roughness on the surface of the base film is formed on a surface of the magnetic film.

#### [CLAIM 17]

... a difference between a height of the convex portion and a height of the concave portion in the roughness on the surface of the magnetic film is 3 nm through 10 nm.

# [DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION] [MEANS TO SOLVE THE PROBLEMS]

[0014]

When an amorphous magnetic film is formed on the base film having the surface on which the roughness is regularly formed, similar roughness reflecting the roughness on the surface of the base film is formed on a

		.,	, ,
			·
		·	

surface of the magnetic film, as schematically shown in Figure 5.

[0015]

The magnetic film concave portion and the magnetic film convex portion are formed with the same material, but have different structures and compositions from each other because the magnetic film concave portion and the magnetic film convex portion generate different stress from each other. When a recording magnetic domain is formed on the magnetic film, the magnetic film concave portion prevents the magnetic-wall movement, thereby pinning the formed recording magnetic domain. In other magnetic film convex section the approximately same the shape as crystal grains which is formed on the convex portion (on the crystal grains) of the base film is magnetically separated from the magnetic film concave portion around the magnetic film convex portion because the magnetic portion convex portion has different magnetic properties from the magnetic film concave portion. Accordingly, the magnetic film convex portion becomes a unit of magnetic reversal, and acts like a magnetic cluster.

[0023]

Kinds of films such as the magnetic film and the intermediate layer, which are formed on the base film, are

,

preferably formed to adhere to the roughness formed on the surface of the base layer so as to maintain the shape of roughness.

[0064]

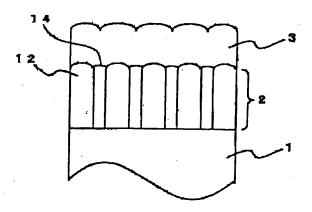
#### [EFFECTS OF THE INVENTION]

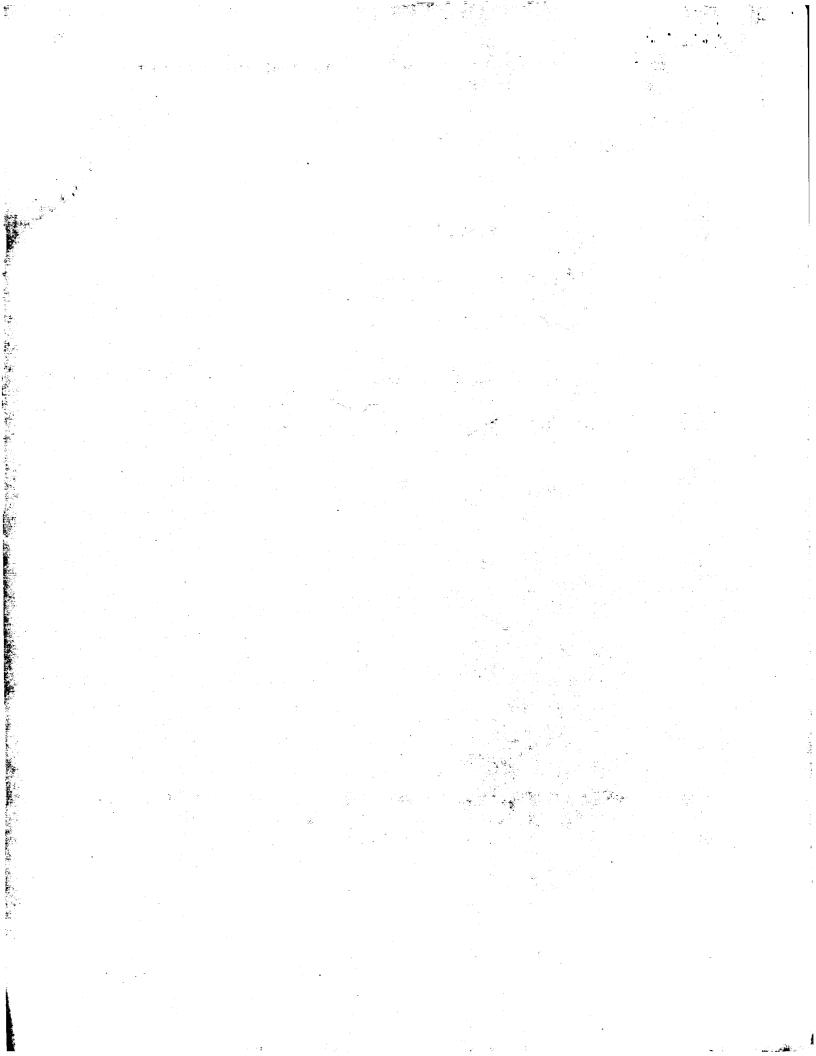
The magnetic recording medium of the present invention is provided with a base film having a surface on which minute and regular roughness is formed by crystal grains and their grain boundaries, and an amorphous magnetic film on the base film. Thus, minute roughness corresponding to the base film is also formed on the magnetic film. The roughness on the magnetic film prevents the domain-wall movement, thereby highly accurately determining the edge position of the magnetic fields formed on the magnetic film.

	·			
			·	·

### [FIGURE 5]







(P2002-83417A) **梅開2002-83417** 

(43)公開日 平成14年3月22日(2002.3.22)

(40年)	G11B 5/738 4K029	C23C 14/06 T 5D006	14/35 F	G11B 5/64	
	5/738	14/06	14/35	5/64	
(51) Int.Cl.?	G11B	C23C		G11B	.•

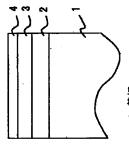
審査開収 未開水 開水項の数18 〇L (全 11 頁)

(21) 汨殿神中	\$2000-271236(P2000-271238)	(71) 出版人 000005810	000005810
			4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
			ロコイクカン祭み取れ
(22) 出題日	平成12年9月7日(2000.9.7)		大阪府炎木市丑寅1丁目1番88号
		(71)田頃(	000005108
			株式会社日立製作所
			東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番4
		(72) 架明者	桐野 文良
			大阪府浆木市丑寅一丁目1番88号 日5
			クセル株式会社内
		(74)代理人 100099793	100099793
			<b>井理士 川北 一百十年</b>

磁気配像媒体及びそれを用いた磁気配像装置 (54) [発明の名称]

「課題】 非晶質の磁性膜に形成される磁区の位置を高 附度に画定でき、高い信頼性を有する磁気記録媒体及び それを備える磁気配録装置を提供する。

凹凸が形成される。磁性膜の凹凸は磁壁の移動を妨げる。 磁区は所望の位置に高精度に固定される。その結果、磁 に凹凸が規則的に形成されている。かかる凹凸を有する 【解決手段】 磁気配録媒体10は基板1上に下地膜2 と磁性膜3とを備える。下地膜2は、二次元的に規則的 に配列した六角形の結晶粒子とそれを取り囲む粒界部か ら構成される。結晶粒子とその粒界によって下地膜要面 下地膜上に形成される磁性膜は下地膜の凹凸に対応した ピンニングサイトとして機能する。磁性膜に形成された 区の揺らぎが低域されるので、エラーが低域され、高い 信頼性を有する磁気配録媒体を提供できる。本発明によ り60Gb/in2を越える超高密度配録を実現でき



保護導 2 下地頭 3番件質

最終買い扱く 7

【請求項4】 上記基板と下地膜との間に、非晶質薄膜 または一定の方位に配向した配向膜を備えることを特徴 とする請求項1~3のいずれか一項に記載の磁気記録媒

類の酸化物からなる無機化合物から構成されていること

を特徴とする請求項1または2に記載の磁気記録媒体。

【請求項5】 上配非晶質薄膜または配向膜は、金属ま たは非晶質無機化合物から形成されていることを特徴と する請求項4に記載の磁気記録媒体。

から構成されていることを特徴とする請求項5に配載の 3N4, C, A12O3, C12O3, S1O2BUN i — Pからなる群から選ばれた少なくとも 1 種類の材料 【静水項6】 上配非晶質薄膜または配向膜が、Hf、 Ru, Ti, Ta, Nb, Cr, Mo, W, Si

【請求項7】 上記下地膜と磁性膜との間に中間膜を備 とする静水項 1~6のいずれか一項に記載の磁気記録媒 r、Mo、W、Ni-P及びCからなる群から選ばれた 少なくとも 1 種類の材料から構成されていることを特徴 え、酸中間膜が、Hf、Ru、Ti、Ta、Nb、C

請求項9】 上配凸部と凹部の高さの差が3 n m ~ 1。 結晶粒界部が凹部を形成していることを特徴とする請求 【謝求項8】 上配下地膜の結晶粒子が凸部を形成し、 項1~7のいずれか一項に配載の磁気記録媒体。

こうる

Onmであることを特徴とする請求項8に記載の磁気記 上配下地膜は、電子サイクロトロン共 [請求項10]

**鳴スパッタ法を用いて形成されていることを特徴とする** 「請求項11】 上記結晶粒子の粒子径分布の標準偏差 5年均粒子径の15%以下であることを特徴とする請求 滑水項1~9のいずれか一項に記載の磁気記録媒体。  $g_1 \sim 10$  のいずれか一項に記載の磁気記録媒体。

【請求項12】 上記結晶粒子は、基板表面に垂直な方

向における構造が柱状構造であることを特徴とする請求 上配結晶粒子は、5 nm~15 nmの 項1~11のいずれか一項に記載の磁気記録媒体。

範囲内の粒子径を有することを特徴とする請求項1~1、 [請求項14] 上配結晶粒界部が、0.5nm以上2 n m以下の幅を有することを特徴とする請求項1~13 2のいずれか一項に記載の磁気記録媒体。

> 上記下地膜は、結晶粒子と当隊結晶粒子を取り囲む非晶 質の結晶粒界部とから構成され、酸結晶粒子及び結晶粒 界部によって下地膜表面に凹凸が形成されていることを 【請求項2】 上配結晶粒子は、基板面に平行な面内に おいて六角形状を有しており、各結晶粒子が基板面に平 行な面内においてハニカム状に配列していることを特徴

特徴とする磁気配録媒体。

**も板上に、下地膜及び非晶質の磁性膜を備え、** 静水項1】 磁気配録媒体において、

【特許数状の範囲】

【請求項15】 1つの結晶粒子の周囲に折出している 結晶粒子数の平均が5.8以上6.2以下であることを 特徴とする請求項1~14のいずれか一項に記載の磁気 のいずれか一項に配載の磁気配録媒体。 配錄媒体。 上記磁性膜の表面に、上記下地膜の数が する請求項1~15のいずれか一項に記載の磁気記録媒 面の凹凸を反映した凹凸が形成されていることを特徴と 【請求項16】

ニッケル及び酸化鉄からなる群から選ばれた少なくとも 1種類の化合物から構成され、上記結晶粒界部は、酸化 ル及び酸化亜鉛からなる群から選ばれた少なくとも 1 種

シリコン、酸化アルミニウム、酸化チタン、酸化タンタ

【請求項3】 上配結晶質粒子は、酸化コパルト、酸化

とする請求項1に記載の磁気記録媒体。

上記磁性膜表面の凹凸の凸部と凹部とり の高さの差が3nm~10nmであることを特徴とする 請求項16に記載の磁気記録媒体。 [請求項17]

【請求項18】 請求項1~17のいずれか一項に記載 は再生するための磁気ヘッドと、上配磁気配録媒体を磁 気ヘッドに対して駆動するための駆動装置とを備える磁 の磁気記録媒体と、上記磁気記録媒体に情報を記録また 気記録装置。

[発明の詳細な説明]

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、高密度記録用の磁 に、微小磁区のエッジの描らぎを低域でき、高性能でか つ高信頼性を有する超高密度記録に好適な磁気記録媒体 気配録媒体及びそれを備える磁気配録装置に関し、特

及びそれを用いた磁気配録装置に関する。 [0002]

磁気記録媒体。

【従来の技術】近年の高度情報化社会の進展にはめざま しいものがあり、各種形態の情報を統合したマルチメデ **ィアが急速に普及してきている。マルチメディアの一つ** としてコンピュータ毎に装着される磁気ディスク装置が 知られている。現在、磁気ディスク装置は、配録密度を また、それに並行して装置の低価格化も急速に進められ 向上させつつ小型化する方向に開発が進められている。

2)磁気記録媒体の保磁力を増大させること、3)信号 【0003】磁気ディスクの高密度化を実現するために 処理方法を高選化すること、4)磁気配録媒体の熱揺ら は、1)ディスクと磁気ヘッドとの距離を狭めること、 ぎを低減すること、等が要望されている。

【0004】磁気配磐媒体において高密度磁気配録を実 現するには、磁性膜の保磁力の増大が必要である。磁気 記録媒体の磁性膜には、Co-Cr-Pt(-Ta)系 の材料が広く用いられていた。この材料は、20nm程 度のC。の結晶粒子が析出した結晶質材料である。かか

小さな粒子が存在していると、熟阂磁や熱揺らぎが生じ このように磁性膜構造や組成を制御することにより、再 5。しかし、結晶粒子サイズに分布が存在し、サイズの る材料を用いた磁気配験媒体において、例えば、40G bit/inch2 (約6.20Gbit/cm2) を 組える面配録密度を実現するためには、配録時や消去時 5磁化反転が生じる単位(磁気クラスター)を更に小さ これは、サイズの小さな粒子がトリガーとなり、この粒 子を核として磁化反転が生じるためである。特に、配録 密度の増大に伴って路区が微細化されると熱域磁や熱語 くするとともに、その粒子サイズの分布を小さくして、 て、形成した磁区が安定に存在できない場合があった。 磁性膜の構造や組織を構密に制御しなければならない。 生時に媒体から発生するノイズを低減することができ らぎの影響は著しい。

レギー、V:活性化体積、k:ボルツャン定数、T:温 **東である。この値が大きいほど、磁性層は熱的に安定で** あることを示す。それゆえ、磁性層の熱的安定性を高め [0005] このように、高密度記録のためには、磁性 団の熱的安定性を高めなければならない。 磁性層の熱的 **安定性については、K u・V∕k・Tで示される値を指** 蔡とすることができる。ここで、Ku:磁気異方性エネ るには、活性化体積V及び磁気異方性エネルギーKuを たきくする必要がある。現時点においてCo系材料で は、Ku・V/k・Tの値は60~70程度である。

許4652499号には基板と磁性膜との間にシード膜 ルギーK u を増大するために、母性膜の超成や構造、更 には、磁気記録媒体の構造を工夫することにより検討さ れてきた。それを実現する方法として、例えば、米国特 [0007]また、活性化体積Vや磁気異方性エネルギ -Kuを増大させるための材料として、例えば、第23 9)には、光磁気配像媒体において用いられている希土 回日本応用磁気学会学格購資会888-11(199 を散ける方法が開示されている。

頃一鉄族系の非晶質合金を用いることが関示されてい [0008]

シード膜を設ける方法を用いて磁性膜における磁性粒子 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述の 径及びその分布を制御することには限界があり、微小な 粒子や粗大化した粒子が混在している場合があった。微 小な粒子や粗大化した粒子は、惰頼を配録する場合(磁 化を反転させる場合)に、周囲の磁性粒子からの環複磁 界の影響を受ける。例えば、大きな粒子は、周囲の粒子 に磁気的な相互作用を与えるために、安定した記録が行 なえないという課題があった。

質合金は磁鹽移動型の材料であるために、情報配録時に 【0009】また、希土類-鉄族系の非晶質合金(希土 類-遷移金属合金)を磁性膜に用いた場合、かかる非晶

**応させる必要があった。また、かかる材料は、配録時や** 肖去時に磁化反転が生じる単位である磁気クラスターの 望の記録磁区を形成することが困難であった。また、磁 ラスターが混在する結果、磁化反転の生じた領域と生じ 全体として粗いジグザグのパターンを呈し、ノイズを増 大させることがあった。このように、非晶質合金を用い て磁性膜を形成した場合は、磁区の位置や磁区の形状の 磁壁位置を高精度に制御して配録磁区の位置を正確に確 間で極めて強い磁気的相互作用が発生しているために所 気的相互作用の強さの違いにより様々な大きさの磁気ク ていない領域との境界線は、図8 (B) に示すように、 30Gbits/cm2)を超える記録密度で情報を記 **削御に課題があり、60Gbit/inch2(約9.** 数することは困難であった。

【0010】本発明は、このような状況に鑑みてなされ に形成することができる磁気配録媒体及びそれを備える たものであり、本発明の第1の目的は、非晶質の磁性膜 に記録磁区を所望の形状及びサイズで所望の位置に確実 磁気配録装置を提供することにある。

【0011】本発明の第2の目的は、磁化遷移領域にお し、情報を低ノイズで再生することができる磁気配録媒 体及びそれを備える磁気配録装置を提供することにあ ける磁区の形状がジグザグパターンになることを防止

n c h <sup>2</sup> (約9.30G b i t s / c m <sup>2</sup>)を越える超 **高密度記録に好適な磁気記録媒体及びそれを備える磁気** 【0012】本発明の第3の目的は、60Gbit/i 妃録装置を提供することにある。

【0006】これまで、活性化体積Vや磁気異方性エネ

【課題を解決するための手段】本発明の第1の態様に従 **晶質の磁性膜を備え、上記下地膜は、結晶粒子と当該結 抜結晶粒子及び結晶粒界部によって下地膜表面に凹凸が 8成されていることを特徴とする磁気配録媒体が提供さ** えば、磁気記録媒体において、基板上に、下地膜及び非 晶粒子を取り囲む非晶質の結晶粒界部とから構成され、 [0013] 53 [0014] 本発明の磁気配録媒体は、基板上に下地膜 規則的に配列した構造を有している。そして、基板上に なり得る。このように表面に規則正しく凹凸が形成され た下地膜上に非晶質の磁性膜を形成すると、図5に模式 的に示すように、この下地膜表面の凹凸を反映して磁性 を備え、当該下地膜は、結晶粒子が非晶質の結晶粒界部 により取り囲まれ、それぞれの結晶粒子が下地膜面内で 形成された下地膜の装面には、規則的に配列された結晶 の周囲の結晶粒界部の装面から突出することにより形成 され得、その結果、結晶粒界部が凹部を画成することに 粒子とその周囲の結晶粒界部とによって凹凸が規則正し く形成されている。下地膜表面の凸部は、結晶粒子がそ 膜の表面にもまた同様の凹凸が形成される。

【0015】例えば、下地膜表面に形成されている凹凸 2

れているが、互いに異なる応力が発生しているために組 の凸部が、下地膜の結晶粒子から形成されている場合に は、磁性膜の表面には、下地膜の結晶粒子に対応した磁 ここで、磁性膜凸部と磁性膜凹部は、同一材料で成膜を 機や組成が異なる。かかる磁性膜に配験磁区を形成する と、磁性膜凹部が磁盤移動の障害となり、形成された配 晶粒界部に対応した磁性膜凹部(盤み)が形成される。 **験徴区がピン止めされる。すなわち、下地膜の凸部上** 性膜凸部が形成され、磁性膜凸部を取り囲むように、

(結晶粒子上) に形成された、結晶粒子とほぼ同一形状 の磁性膜凸部は、その周囲の磁性膜凹部と異なる磁気的 性質を有するために磁性膜凹部と磁気的に分断され、磁 性膜凸部が磁化反転単位となって、あたかも磁気クラス ターのように披舞う。このように、下地膜の微細な凹凸 なピン止めとして作用するので、磁性膜として磁盤移動 型の非晶質材料を用いたとしても、磁区と磁区との間に 形成される磁盤の移動を有効に防止し、磁性膜に所望の 形状及び寸法の配録磁区を所望の位置に形成することが 可能となる。また、下地膜の凹凸を反映して形成された 磁性膜の凹凸は、磁気ヘッドが磁気配像媒体に吸着する 【0016】また、下地膜の結晶粒子の寸法を制御する ことによって上述の磁気クラスター(磁化反転単位)の 大きさを制御することができるので、下地膜の結晶粒子 を微小化することにより高密度配録を実現することがで きる。例えば、60Gbits/inch2の配録密度 を実現するには、結晶粒子サイズを5nm~15nm程 度にすればよく、更に配録密度を高めるには結晶粒子サ を反映して形成された磁性膜の凹凸が物理的(構造的) ことを防止するためのテクスチャとしても有効である。 イズを更に微小にすればよい。

構造を形成していることが好ましい。また、一個の正六 【0017】本発明の磁気記録媒体において、下地膜の 一つの枯晶粒子は、図3に示すように、基板面に平行な 基板面に垂直な断面ではその結晶粒子が上方に柱状に成 **長した構造を有していることが好ましい。特に、結晶粒** 子の柱状の断面は、下地層の成長とともに弱状に広がる ことなく、結晶粒界部の幅が均等な構造を有しているこ とが好ましい。このような、一つが正六角柱をなす結晶 粒子の集合体は、正六角柱が規則的に配列したハニカム 角形の結晶粒子の周囲に存在する粒子の個数は、平均で 5.8~6.2個であることが好ましい。また、結晶粒 子サイズの分布が、統計学的な標準偏差:o が粒子サイ ズの分布が正規分布または正規分布に近い分布であるこ 面内における形状が正六角形状であることが好ましく、 ズの15%以下であることが好ましく、更に、粒子サイ とが好ましい。

一同士の距離は、下地膜中の結晶粒子間の距離すなわち 結晶粒界の幅を制御することによって調整でき、磁気ク ラスター間で働く磁気的相互作用を弱めるには、0.5 [0018] ここで、磁性膜に形成される磁気クラスタ

n m以上2nm以下が好適である。

酸化コパルト、酸化コッケル及び酸化鉄から選ばれる少 ンタル及び酸化亜鉛から選ばれる少なくとも1種類の酸 なくとも1種類の化合物が好適であり、結晶粒界部は、 [0019] 本発明において、下地膜の結晶質粒子は、 酸化シリコン、酸化アルミニウム、酸化チタン、 化物が年過である。

例えばC。Oは非磁性を示すが、酸菜濃度を制御してC うにすることができる。酸化コパルトに限らず、酸化鉄 や酸化ニッケルについても同様である。下地膜の結晶粒 子に磁性を持たせて、下地膜の結晶粒子上に形成される 磁性膜とのみ磁気的に結合させ、結晶粒子の周囲の結晶 粒界部上に形成される磁性膜とは磁気的に結合させない ようにすれば、下地膜の結晶粒子上に位置する磁性膜の ピン止め効果をより一層促進させることができる。すな わち、下地膜の結晶粒子上に位置し、結晶粒子とほぼ同 一の形状を有する磁性膜部分 (磁気クラスター) を、そ の周囲の磁性膜部分から磁気的に孤立させることが可能 となり、前述の構造的なピン止めのみならず、磁気的に が磁性を有するように構成することもできる。下地膜に o304をCoOに含ませることにより、磁性を示すよ ストイキオメトリーを制御することにより実現できる。 磁性を持たせるには、下地膜中の結晶粒子を、例えば、 【0020】また、本発明の磁気配録媒体では、 ピン止めすることが可能となる。

[0021]また、本発明の磁気配録媒体は、基板と下 地膜との間に、非晶質薄膜または一定の方位に配向した 配向膜を備えることができる。非晶質薄膜または配向膜 は、基板と下地膜との接着性を向上させたり、下地膜に 初期成長層が形成されることを抑制したりすることがで きる。非晶質薄膜または配向膜を構成する材料は、金属 または非晶質無機化合物が好ましく、例えば、Hf、R C. A1203, Cr203, SiO2&UNi-Ph u, Ti, Ta, Nb, Cr, Mo, W, Si3N4, ら選ばれる少なくとも1種類の材料が好適である。

磁性膜との間に、下地膜中の遊離の酸素が磁性膜を構成 する材料と反応することを防ぐための中間酸を形成して 【0022】また、本発明の磁気記録媒体は、下地膜と Ni-P、Cのうちより選ばれる少なくとも1種類の材 H, Hf, Ru, Ti, Ta, Nb, Cr, Mo, W, も良い。かかる中間膜を構成する材料としては、例え

【0023】また、下地膜上に形成される種々の膜、例\* ている回凸と密格して回凸形状を維持した状態で形成さ えば、磁性膜や上述の中間膜は、下地膜表面に形成され 界面が良好に密着していることが好ましい。より好まし れることが好ましい。すなわち、下地膜と磁性膜との界 の界面を、例えば低子顕微鏡により観察したときに、各 面、下地膜と中間膜との界面、または中間膜と磁性膜と 料が好適である。

くは、下地膜上に形成される磁性膜が下地膜の表面の組

€

			, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	. ,
		·		
			·	

**徴及び形状を反映し、下地膜の結晶粒子に対応する磁性** 膜部分が構造的及び磁気的に孤立して磁化反転の単位と

缶は、パイアス亀田の印加の方法により、ターゲット粒 **比を用いて下地膜を形成することにより、複雑なスパッ** タ条件を必要とせずに、所留の形状のハニカム構造を形 成することができる。また、結晶粒子とその粒界によっ て画成される凹凸を下地膜全体にわたって所望の高さで 【0024】本発明において、上述したような規則正し い凹凸を有する下地膜の成膜には、電子サイクロトロン 共鳴 (ECR) スパッタ法が好適である。このスパッタ 子の運動エネルギーを揃えることができ、且つそのエネ ルギーをより精密に制御できる。 特に、ECRスパッタ 均一に形成することができる。

ープや後細な砥粒を用いて研磨して磁気ディスクの表面 することができるが、下地膜に20mm以下の凹凸を生 **蚕性良く形成することは困難であると考えられる。上述** のECRスパッタ法を用いれば、下地膜にナノメートル いる。かかる方法を用いても下地膜に微細な凹凸を形成 【0025】従来、磁気ヘッドが磁気ディスクに吸着す 5ことを防止するために、磁気ディスクの設面を研磨テ に做細な回凸 (テクスチャ) を形成する方法が知られて **ナーダーの凹凸を高精度に且つ生産性良く形成すること**  [0026] 本発明の第2の簡様に従えば、本発明の第 **報を記録または再生するための磁気ヘッドと、上記磁気** 1の想様に従う磁気記録媒体と、上記磁気記録媒体に情 記録媒体を磁気ヘッドに対して駆動するための駆動装置 とを備える磁気記録装置が提供される。 【0027】本発明の磁気配験装置は、本発明の第1の inch 2 (約9.30Gbits/cm2)を超える面 る。また、本発明の磁気配縁装置は、60Gbits/ 段、コードデータ、画像情報等の情報を高密度記録で 協様に従う磁気配録媒体を装着しているので、音声情 き、記録された情報を低ノイズで再生することができ 記録密度で情報を記録することができる。

ドは、磁気記録媒体に記録された情報を再生するための 磁気抵抗効果案子)やGMR案子 (Giant Magneto Resi stive案子;巨大磁気抵抗効果案子)、TMR案子 (Tun neling Magneto Resistive繋子;磁気トンネル型磁気抵 とにより磁気配験媒体に配験された情報を高いS/Nで 【0028】本発明の磁気記録装置において、磁気ヘッ 抗効果素子)を備え得る。これらの再生案子を用いるこ 再生業子として、MR業子(Magneto Resistive業子; 再生することができる。

[0029]

、発明の実施の形態』以下、本発明の磁気記録媒体及び それを備える磁気配録装置について実施例を用いて更に 詳細に説明するが、本発明はこれに限定されるものでは

[0030]

[実施例] 本実施例では、本発明に従う磁気記録媒体と (下地膜) 2、磁性膜3及び保護膜4を積層した構造を 有する磁気配縁媒体10を作製した。以下に、かかる磁気配象媒体の製造方法、並びに、下地膜、磁性膜及び磁 J. T.、図1に示すような、基板1上に無機化合物薄膜 気配録媒体の特性測定の結果について説明する。 【0031】 (ECRスパッタ装置] まず、磁気配験媒 体の無機化合物薄膜を成膜する際に用いるECRスパッ タ装置について説明する。図2に、ECRスパッタ装置 の断面構造を概念的に示した。

連結された環状のターゲット70と、ターゲット70の 【0032】ECRスパッタ装置80は、プラズマが発 生する第1チャンパ81と、第1チャンパ81の上方に 上方に連結された第2チャンパ83とを主に有する。第 1チャンパ81は、石英製の円筒管であり、軸方向の上 て設けられている。第1チャンパ81には、マイクロ波 発生器74が導入管を介して連結されており、導入管は 第1チャンパ81のコイル64と66との間に連結され アス電圧が印加できるように、電源90に接続されてい **方及び下方に一対のコイル64、66がそれぞれ周回し** ている。第2チャンパ83は金属製の真空チャンパであ り、その頂部には、ターゲット70から叩き出された粒 子を堆積させる基板68が設置されている。さらに、第 2チャンパ83の上方には、印加されたバイアスにより る) ためのコイル62が散けられている。ターゲット7 0と第2チャンバ83内に設置された基板68は、バイ 引き出されたプラズマを収束させる(発散を抑制させ

【0033】第1チャンパ81内部、ターゲット70の Ar)を導入する。次いで、装置内部にコイル64及び て、装置内部に存在する自由電子は、磁界軸を右回りに 故領域の角板動数となる。この磁場内にマイクロ故発生 内側及び第2チャンパ内部は連通され、外部から閉塞さ れている。装置動作時に不図示の真空ポンプにより、第 ンパ81内に不図示のガス供給ロを介して気体(例えば サイクロトロン運動する。この電子サイクロトロン運動 の角振動数は、例えば、電子密度が1010cm-3程 度である場合には、約109Hz程度であり、マイクロ 器14から、発生したマイクロ被を導入すると、マイク ロ波は電子のサイクロトロン運動と共鳴し、そのマイク る。この共晦吸収によって電子は高エネルギーを得て加 **パ81内に発生させる。ここで、電子には共鳴吸収によ** り一定レベルのエネルギーが与えられるので、粒子のエ l チャンパ8 1 内部、ターゲット 7 0 内側及び第2チャ ンパ83内部の共有の空間を域圧すると共に、第1チャ 高エネルギーを有するECRプラズマ16を第1チャン 速され、気体に衝突してその気体の電離を引き起こし、 66を用いて一定の磁界を印加する。この磁界によっ ロ故のエネルギーが電子に吸収される共鳴吸収が起こ

このような電子を気体に衝突させてプラズマを発生させ るため、このブラズマを構成する粒子は商エネルギーで あると共に、放電などにより発生する通常のプラズマに 比べて各粒子のエネルギーが描い、エネルギー分布の狭 ネラギー状態もまた一定の高エネラギーアベラにある。 いプラズマが得られる。

向かって引き出され、ターゲット70に衝突してターゲ 【0034】プラズマの発生位置の上方にある環状のタ ーゲット70と基板68の間には、パイアス電圧が印加 されているため、発生したプラズマはターゲット70に ット粒子を叩き出す。この際に、パイアス亀圧を変化さ せることによって、ターゲット70に衝突するプラズマ の運動エネルギー、ひいてはプラズマによって叩き出さ れたターゲット粒子の運動エネルギーを精密に制御する ことが可能となる。このようにしてエネルギーが制御さ れたターゲット粒子は、図示したようにターゲット粒子 の流れ12として基板68に向かい、 基板68上に均質 にかつ等しい膜厚で堆積する。

置を用いてガラス基板1上に無機化合物薄膜2を成膜し 【0035】 [下地膜の作製] かかるECRスパッタ装 4:1に混合して焼結したものをターゲットに、放電ガ スには純Aェをそれぞれ使用した。スパッタ時の圧力は 0. 3mTorr、投入マイクロ波電力は0. 7kWで ある。また、基板には500WのRFバイアスを印加し た。無機化合物薄膜の成膜では、CoOとSiO2を た。作製した薄膜の膜厚は30nmである。

【0036】得られた無機化合物薄膜2の装面及び断面 観察された薄膜の平面構造の模式図を図3に示す。図3 に示したように、無機化合物薄膜2は、粒子径が10n mの正六角形の粒子12がハニカム状に配列した集合体 であり、各粒子は互いに粒界部14を介して二次元的に 8 n m であった。粒子径及び粒子間の距離は、無機化合 物薄膜2の成膜に用いるターゲットの組成(CoOとS することができる。また、薄膜2の断面構造を観察する と、図4に示すように、正六角形の粒子12が基板面に かかる柱状組織は、途中で結晶粒子が大きくなるなど異 〇2の比など)を変化させることにより、任意に選択 の構造を透過型電子顕微鏡(TEM)により観察した。 規則正しく配列していた。粒子間の距離は0.5~0. 対して垂直方向に柱状に成長していることがわかった。 常成長することなく成長していた。

について、ランダムに選択した280個の結晶粒子につ

いて聞べた。その枯果、平均で6.02個であった。こ

のことは、結晶粒子の粒径のばらつきが少なく、基板面 に平行な面内で結晶粒子の正六角形がハニカム状に極め

て規則的に配列していることを示している。

【0037】また、薄膜表面には、規則性に優れた凹凸 が存在しており、凸部が粒子12に相当し、凹部が粒界 り、逆に小さくしたりすることができる。すなわち、エ ッチング条件を選択することにより所望の値に制御可能 る磁盤のピンニングサイトになるには、上記範囲が好適 nm程度であった。この高低差は、無機化合物薄膜の表 面をドライエッチングすることにより、更に大きくした である。磁気ヘッドを安定洋上させたり、磁性膜におけ **部14に相当していた。凸部と凹部との高低差は6~7** 

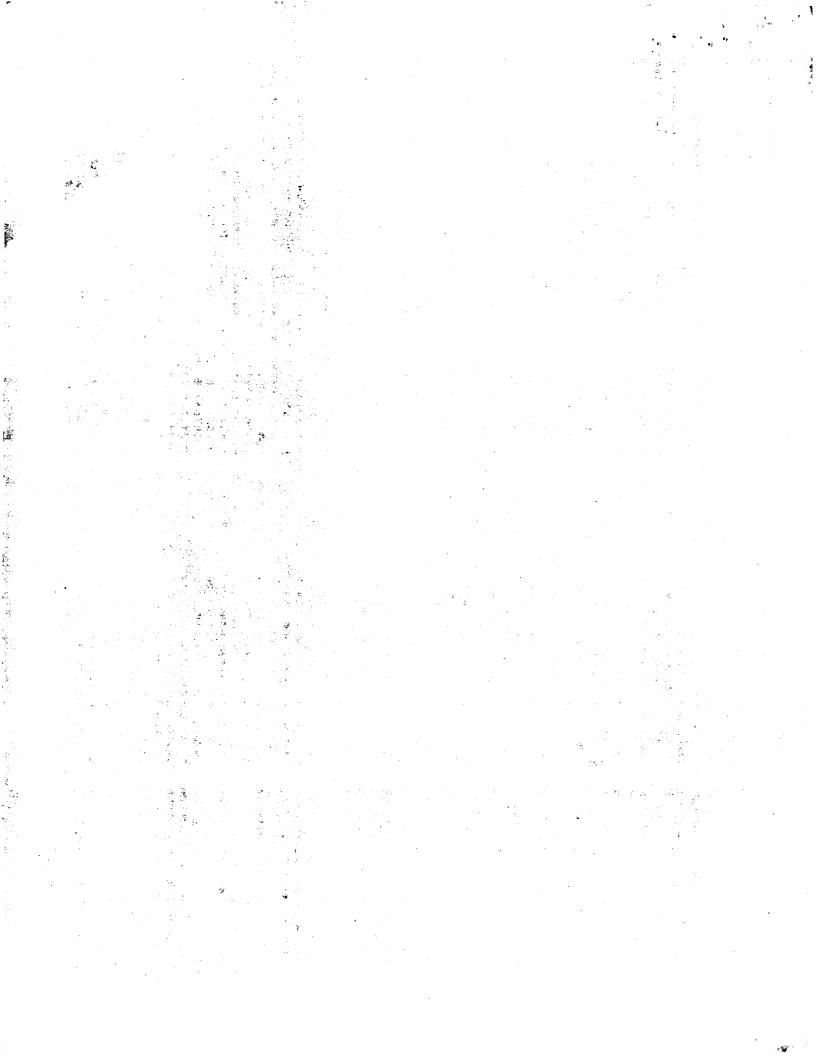
である。また、薄膜表面を巨視的に観察したところ、う ねりが形成されており、その周期は150nm~160 nm程度であった。うねりの周期が短すぎるとテクスチ **ナとして機能せず、磁気ヘッドを媒体上で浮上させたと** きに、磁気ヘッドと媒体との距離が離れるために好まし くない。また、うねりの周期が長すぎても高密度配録に 脳さない。

た、無機化合物薄膜の格子像観察を行なったところ、粒 子12のコパルト酸化物は結晶質であり、粒界部14の [0038] また、無機化合物薄膜2のエネルギー分散 界部14を分析したところ、粒子12は主にコパルトの 酸化物であり、粒界部14に存在しているのは主に酸化 シリコンであることがわかった。ここで、粒子12のコ パルト酸化物中には酸化シリコンが微量含まれ、また粒 界部14の酸化シリコンにはコバルト酸化物が微量含ま れているが、その組織や物性に及ぼす影響は小さい。ま 型X線分析(μ-EDX)を行なって粒子12とその粒 敬化シリコンは非晶質であることがわかった。

【0039】 つぎに、上述の無機化合物薄膜の表面のT

EM観察結果を用いて、結晶粒子径の分布及びある1つ 存在している粒子について鬩べた。その結果、平均結晶 た。このように粒子径分布が小さいのは薄膜形成にEC Fマグネトロンスパッタ法を用いて薄膜を形成した場合 CRスパッタ法を用いて薄膜を形成する方法は髙密度記 は、ランダムに選択した一辺が200mmの正方形中に 粒子径は10mmであった。粒子径の分布は正規分布を Rスパッタ法を用いたためである。RFスパッタ法やR 録という観点から極めて有効な方法である。配位粒子数 の結晶粒子の周囲に存在している結晶粒子の数(以下、 配位粒子数と呼ぶ)を解析した。結晶粒子径について しており、標準価差を求めると0.6 n m以下であっ では、粒子径分布は1.0ヵm程度であることから、

結晶粒子間の距離は、ターゲットの組成(CoとSiの 【0040】この配位粒子数は、結晶粒子間の間隔に依 存して変化する。ここで、SiO2は構造に規則性を持 る結晶粒子の間隔を決定していることが分かった。この くすると、この結晶粒子関距離は長くなる。結晶粒子関 02歳度を低くすると結晶粒子間の距離は狭くなる(結 たせる重要な役割を有しており、SiO2機度は形成す 比、あるいはCoOとSiO2の比等) を変化させるこ とにより所望の値を容易かつ任意に避択することができ る。例えば、C o O ~ S i O 2 膜中の S i O 2 徹度を多 の距離は、基板温度を上げるなどの成膜プロセスを漫適 化することにより変化させることができる。一方、Si 晶粒子どうしが接近する)。それと同時に、粒子形状に



**込れが観測された。配位粒子数は、7個程度と多い粒子** り、ばらつきが大きくなった。また、二次元の配列に乱 筋例では、この範囲に含まれるようにSiO2撥度の制 適当な結晶粒子関隔範囲はO.5~2nmであり、本実 があったり、逆に4~5個と少ない粒子が存在してお れが生じ、ハニカム構造が崩れているのが観察された。

り形成した。マグネトロンスパッタ社により形成した無 【0041】また、比較のために無機化合物薄膜をEC 機化合物薄膜の構造を、TEMによる観察像を用いて前 た。その結果、平均粒子径は10mmであり、粒子径分 が大きかった。また、配位粒子数を280個の結晶粒子 スパッタ 法を用いて形成した場合に比べて規則性が低下 していることが分かった。この比較実験から、ECRス パッタ法を用いて無機化合物薄膜2を形成すると、薄膜 2の規則性を大きく改善でき、角密度配録に有利な膜が 2nmであり、ECRスパッタ法により形成した膜の標 について個ペたところ、平均6.30個であり、ECR Rスパック法に代えてRFマグネトロンスパッタ法によ 幣偏差(σ) 0. 7 nmと比較すると粒子径のばらつき 布は正規分布をしているものの、標準偏差 (σ) は1. 述のECRスパッタ社による膜の場合と同様に解析し 得られることがわかった。

して用いたが、これらの各化合物を単体で焼結したもの 機化合物薄膜の成膜において重要なことは、マイクロ波 を用いたECRスパッタ社を用い、スパッタ粒子のエネ 【0043】また、無機化合物薄膜の成膜において、膜 【0042】上述の無機化好物薄膜の成膜では、ターゲ ットとして、CoOとSiO2との混合したものを焼桔 シターゲットに用い、二元同時スパッタにより成膜して もよく、成膜法やターゲットの種類には依存しない。無 **ルギーを精密に制御することである。** 

ズおよびサイズ分布などに、膜厚に依存した変化は見ら 上、安定して作製することが困難であり、また、100 も得られる膜の数面および断面の組織や構造、粒子サイ nm以上では成版に時間がかかるとともに、膜の内部応 力が増して膜が基板から剥離するので製造上の制限があ **厚を5mm程度としても、逆に、100mmと厚くして れなかった。5nm以下の膜厚では、成膜装置の都合** 

【0044】 (磁性膜の成膜) つぎに、無機化合物薄膜 上に情報配録用の磁性膜3として、Tb15Fe70C Tb-Fe-Co合金をターゲットに、純Arを放電ガ た。かかるTb-Fe-Co膜の組成は、遷移金属の副 スにそれぞれ使用した。形成した磁性膜の厚さは20n mである。スパッタ時の圧力は20mTotr、投入R 格子磁化が優勢となる組成である。スパッタの際には、 o 1 5 膜をRFマグネトロンスパッタ法により成膜し F電力は1kW/150mm 6である。

【0045】かかる磁性膜を成膜する前に、無機化合物

3N4などの窒化物膜を形成し、これらの膜を介して磁 性膜を成膜してもよい。かかる金属膜や蜜化物膜は、磁 性膜 (Tb-Fe-Co膜)の保護や凹凸の制御に効果 薄膜上に、Cr、Ti、Nb、A1などの金属膜やSi

【0046】また、磁性膜表面に形成される凹凸は、無 機化合物薄膜表面の凹凸を反映しているが、成膜方法や 成膜条件を選択することにより所望の凹凸 (平坦を含 む)を得ることができる。

【0047】 [保護膜の成膜] 次いで、磁性膜3上に保 3mTorr、投入マイクロ液電力は1kW (周波数は 93GHz)、基板温度は室温である。マイクロ数 なお、カーボンは導電体であるのでDC亀圧を印加して 嬢膜4として、ECRスパッタ法によりカーボン薄膜を により励起されたプラズマを引き込むためのRFバイア スをターゲットに印加した。その値は500wである。 形成した。ターゲットにはカーボンターゲットを用い、 **<b><b><u><b><b>**</u>**枚電ガスにはArを使用した。スパッタ時の圧力は0.**</u> 引き込んでも同様の効果が得られる。

徴館にて観察したところ、カーボン膜は3ヵm膜厚でも アイランド状になることなく全体にわたって均一な膜を 【0048】こうしてカーボン膜を膜厚3mmで成膜し た。得られたカーボン膜の組織を高分解能透過型電子顕 形成していた。

**に、保護膜の膜厚を次第に薄くして形成したところ、膜** 分な解析を行なうことはできなかった。しかし、保護性 く、アイランド状にはならなかった。膜厚を1nmより も更に薄くしたが、電子顕微鏡の分解能以下になり、十 能を考えると、少なくとも1nm程度以上の膜厚が必要 [0049] ここで、保護膜の保護性能を調べるため **草が1nmになっても保護膜のカバレージに変化はな** であると考えられる。

【0050】また、カーボン膜の密度を、体積が既知の ろ、ECRスパッタ法により作製したカーボン膜の密度 以料を溶解して濃度を定量する方法により求めたとこ は理論密度の69%であった。

【0051】こうして図1に示す積層構造を有する磁気 記録媒体10を作製した。

【0052】 (磁気配録媒体の賭特性) つぎに、得られ た磁気配録媒体の磁気特性を測定した。 V SM (Vibrat プを得た。その結果から、角型比のSおよびS\*はとも た、基板面に対して垂直方向の垂直磁気異方性エネルギ ーが6×106erg/cm³であり、 基板面に垂直な に1.0であり、良好な角型性が得られた。また、保磁 力:Hcは3.5kOe (約278.53kA/m)、 ing Sample Magnetometer) による関定からM-Hルー 飽朽磁化:Msは500emu∕cm3であった。ま 方向に大きな磁気異方性を有する磁性体であった。

[0053]この磁気配録媒体の活性化体積を測定した so ところ、磁気配録媒体として広く用いられているCo-

著しく大きかった。このことは、この磁性膜が熱的安定 Cr-Pt系磁性膜における値(約70)の約30倍と 性に優れていることを示している。

質合金を用いたが、Tbからなる層、Feからなる層及 悶べたところ、回折ピークは得られず、X級的には非晶 質であった。また、高分解能透過型電子顕微鏡(高分解 能TEM)により組織や構造を擱べたところ、明確な格 子は見られず、非晶質か、極微細な組織の集合体である ことがわかった。ここで、Tb-Fe-Co膜には非晶 びCoからなる層を交互に積層して構成されるTb/F e/Co多層膜や、Tbからなる層とFe-Co合金か らなる層とを交互に積層してなるTb/Fe-Co多層 [0054] つぎに、磁性膜の構造をX線回折法により 膜のような、希土類元業と鉄族元素の交互積層多層膜 (人工格子膜) を用いても同様の効果が得られた。

によって磁気ディスクを完成させた。そして同様のプロ に同軸上に組み込んだ。磁気配録装置の概略構成を図6 を有する磁気配録媒体の表面上に潤滑剤を塗布すること セスにより複数の磁気ディスクを作製し、磁気記録装置 【0055】 (磁気記録装置) つぎに、かかる磁気特性

は一体化されており、図6及び図1では磁気ヘッド53 [0056]図6は磁気記録装置100の上面の図であ り、図7は、磁気記録装置100の図6における破線A 膜磁気ヘッドを用いた。また、配録信号は、巨大磁気抵 抗効果を有するデュアルスピンバルブ型GMR磁気ヘッ unであった。記録用磁気ヘッド及び再生用磁気ヘッド として示した。この一体型磁気ヘッドは磁気ヘッド用駆 2. 1丁の高飽和磁束密度を有する軟磁性膜を用いた薄 ドにより再生した。磁気ヘッドのギャップ長は0.12 - A'方向の断面図である。記録用磁気ヘッドとして、 動系54により制御される。

により回軸回覧される。ここで、鎌釭ヘッド面と母有駁 との距離は12nmに保った。この磁気ディスク51に 50Gbits/inch<sup>2</sup> (約7.75Gbits/ 磁気ディスクのS/Nを評価したところ、30dBの再 トを測定したところ、借号処理を行なわない場合の値で 【0057】複数の磁気ディスク51 はスピンドル52 生出力が得られた。また、この磁気ディスクの欠陥レー cm2)に相当する信号(800kFC1)を記録して 1×10-5以下であった。

であることもノイズレベルが低い原因である。また、従 て、配録した部分の磁化状態を観察した。その結果、磁 されるような特有なジグザグパターンは観測されなかっ 比べて著しく小さくなっている。また、磁性膜が非晶質 **化遷移領域には、従来の結晶質系の磁性膜において観測** た。このように本実施例の磁気配験媒体では磁化避移質 メレベルがCo-Cr-Pt※の従来の磁気記録媒体に 域にジグザグパターンが形成されていないために、ノイ 【0058】ここで、磁気力顕微鏡 (MFM)を用い

の磁気記録媒体では、瞬同士の記録磁区の間や記録磁区 来の磁気記録媒体では、瞬间士の記録磁区の間や記録磁 の磁化を有する微小な逆磁区が観察されたが、本実施例 区の中に、反磁界の影響によって生じる、周囲と逆向き の中に、微小な逆磁区は殆ど観察されなかった。瞬同士 の記録磁区の間や記録磁区の中に、微小な逆磁区が殆ど 存在しないこともノイズレベルが低い原因の1つであ

形成したために、下地膜の凹凸に対応して形成された磁 性膜の凹凸が磁壁の移動の障害となったからである。磁 なお、図8 (A) においては、ジグザグパターンが下地 騒気記録媒体に比べて、エッジの揺らぎは1/10以下 【0059】本実施例の磁気記録媒体において、磁化避 え、凹凸の構造や形状を考慮して信号処理を行なうこと に、下地膜の六角形状の凸部2個程度を磁化反転の単位 (配録磁区) として模式的に示している。 ジグザグパタ 一定のパターンを磁気配録媒体に記録し、タイムインタ ーパルアナライザ(TIA)により磁区のエッジの描ら ぎを砌定した。砌定の結果、無機化合物薄膜を備えない 表面に凹凸を有する無機化合物膜を磁性膜の下地として ザグパターンが形成されている。かかるジグザグパター ンは、無機化合物薄膜の表面に存在する凹凸に依存して 璧部分においては、図8 (A) に示すように僅かにジク 10 移倒域に、ジグザグパターンが観測されなかったのは、 により、更に高S/Nで情報を再生することができる。 **ーンの変化はジッタの変化として観測できる。そこで、** 形成されるものであり、規則性を有している。それゆ 膜の凹凸に沿って形成される様子を強関して示すため に和減したいた。

【0060】以上、本発明に従う磁気配録媒体及びそれ が、本発明はこれに限定されるものではなく、種々の改 を備える磁気記録装置について実施例により説明した

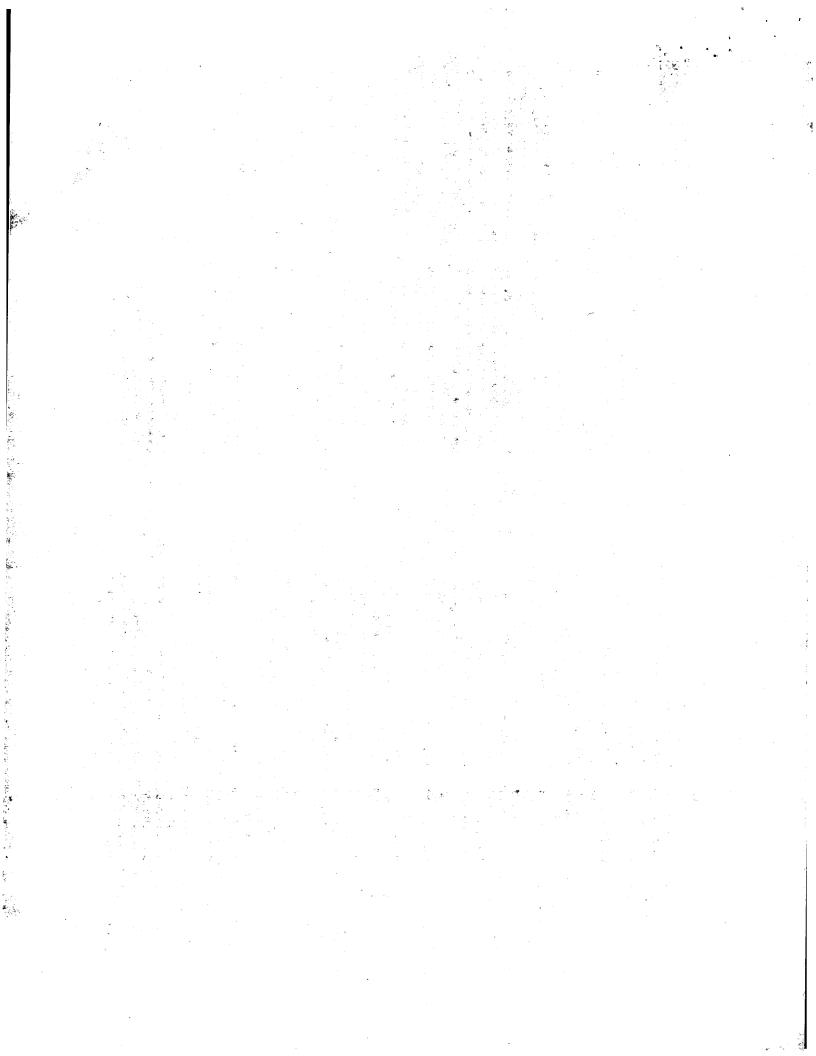
ខ្ល

たが、例えば、Hfなどの非晶質の膜を介して無機化合 物薄膜を形成して磁気配録媒体を構成してもよい。これ により、無機化合物薄膜の初期成長層の形成を抑制する ことができるので、無機化合物薄膜の結晶粒子の配列の [0061] 例えば、上記実施例では、無機化合物膜2 W, Si3N4, C, A12O3, Cr2O3, SiO をガラス基板1上に直接成膜して磁気配録媒体を作製! 規則性や結晶性を更に向上させることができる。また、 H {以外に、Ru、Ti、Ta、Nb、Cr、Mo、 良例及び変形例を含み得る。

ンスを利用したスパッタ法 (ECRスパッタ法) を用い て行ってもよい。また、磁性膜として、Tb-Fe-C 2、Ni-Pなどの材料を用いても同様の効果を得るこ 【0062】また、上配実施例では、磁性膜を、RFマ グネトロンスパッタ法を用いて成膜したが、DCマグネ トロンスパッタ社やエレクトロンサイクロトロンレンナ とができる。

系の非晶質合金膜を用いたが、これ以外に、例えば、

**⊛** 



6

91

o, Tb-Gd-Fe-Co, Tb-Dy-Fe-Co Gd-Fe-Co, Dy-Fe-Co, Ho-Fe-C などの希土類と鉄族の合金膜や多層膜、更には、P t

(あるいはPd) /Co交互積層多層膜などの磁壁移動

[0063]また、磁性膜と無機化合物薄膜との間に中 **関膜を散けることもできる。これによりディスクの信頼** W、NiーP、Cなどの元業や、これちの元霖を母元業 化合物薄膜との間に設けることにより、無機化合物層か ら磁性膜中への酸素が拡散することを抑制することがで 性をさらに向上させることができる。中間膜に用いる材 きる。それゆえ、磁性膜の磁気特性の変動が抑制される とし、これに母元棻以外の元素を添加した合金が好まし い。これらの材料から構成される中間膜を磁性膜と無機 科は、Hf, Ru, Ti, Ta, Nb, Cr, Mo, ので、磁気配録媒体の信頼性を向上させることができ 型の情報記録用の磁性膜を用いてもよい。

成された下地膜を有し、この下地膜上に非晶質の磁性膜 を備えるので、磁性膜にも下地膜に対応した微細な凹凸。 の粒界によって設面上に微細で且の規則圧しい凹凸が形 が形成されている。かかる磁性膜の凹凸は、磁脳の移動 発明の効果】本発明の磁気配験媒体は、結晶粒子とそ の障壁となって磁性膜に形成された磁区のエッジ位置を **髙精度に画定することができる。それゆえ磁性膜に形成** される記録磁区の揺らぎが低域され、低ノイズで且つ高 い信頼性で情報を再生することができる。 [0064]

【0065】本発明の磁気記録媒体及びその磁気記録媒 体を装着した磁気配像装置は、60Gbits/inc h 2を越える高配偸密度で情報を記録することができ

【図1】本発明の磁気記録媒体の断面構造を模式的に示 [図2] ECRスパッタ装置の概略構成を示す図であ 【図面の簡単な説明】 ず図である。

【図3】無機化合物薄膜の平面構造の概略を示す図であ

【図4】無機化合物薄膜の断面構造の概略を示す図であ

[図5] 無機化合物薄膜とその上に成膜された磁性膜の **新面構造の概略を示す図である。** e 2

[図7] 図6の磁気配録装置のA-A、方向における断 【図6】本発明に従う磁気記録装置の概略構成図であ

り、図8 (A) は本発明の磁気配験媒体の磁化遷移領域 の様子であり、図8 (B) は従来の磁気配験媒体の磁化 【図8】磁化遷移領域の様子を模式的に示した図であ 面図である。

遷移領域の様子である。 [符号の説明]

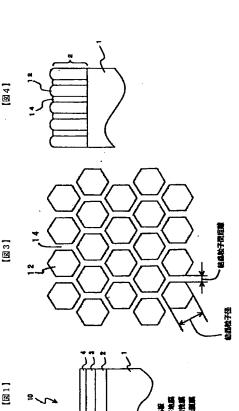
2 無機化合物薄膜 磁性膜

保護膜

5.1 磁気ディスク

5.4 協気ヘッドの駆動株 5.3 研究ヘッド メゲンドル

[図7] [ 图 图 [図2] 超回计 医医 Ð 3 [図6] [図2]



医阿比

			· · · · · · · · · · · ·	•. • •
·				

フロントページの結束

(72) 発明者	太田 医原雄		(72) 発明者	稲葉 信奉
	大阪府茂木市丑寅一丁目1番88号	日立マ		大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号 日立マ
	クセル株式会社内			クセル株式会社内
(72)発明者	女女 阿里		(72) 発明者	本田 光利
	大阪府茨木市丑宜一丁目1番88号	日立マ		茨城県日立市大みか町七丁目1番1号
	クセル株式会社内			式会社日立製作所日立研究所内
(72)発明者	矢野 充		(72) 発明者	山木 浩貴
	大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号	日立マ		茨城県日立市大みか町七丁目1番1号
	クセル株式会社内			式会社日立製作所日立研究所内
(72)発明者	坂本 暗美		(72) 発明者	中澤 哲夫
	大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号	日立マ		茨城県日立市大みか町七丁目1番1号
	クセル株式会社内			式会社日立製作所日立研究所内
(72)発明者	若林 康一郎		(72) 発明者	内藤 幸
	大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号	日立マ		茨城県日立市大みか町七丁目1番1号
	クセル株式会社内			式会社日立製作所日立研究所内
(72)発明者	松沼 语		Fターム(巻	Fターム(参考) 4K029 AA09 BA02 BA03 BA06 BA07
	大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号	4.		BA09 BA11 BA12 BA16 BA17
	クセル株式会社内			BA21 BA26 BA32 BA34 BA35
				BA43 BA44 BA46 BA48 BA58
				BB02 BD11 CA05 DC09 DC48
•				5D006 BB07 CA01 CA05 CA06 EA03
				991

			The second of th
			-
<b>`</b> .			
		,	
	·		
	-		